

立即发布

投资者关系:

Ed Lockwood

投资者关系高级总监

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系:

Meggan Powers

企业宣传高级总监

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 宣布推出新型 Teron™ SL650 光罩检测系统

高产能和 193nm 技术有助于集成电路晶圆厂

更经济地监测 20nm 以下设计节点光罩

【加州 MILPITAS 2014 年 5 月 20 日讯】今天，[KLA-Tencor 公司](#)（纳斯达克股票代码：KLAC）宣布推出 Teron™ SL650，该产品是专为集成电路晶圆厂提供的一种新型光罩质量控制解决方案，支持 20nm 及更小设计节点。Teron SL650 采用 193nm 光源及多种 STARlight™ 光学技术，提供必要的灵敏度和灵活性，以评估新光罩的质量，监控光罩退化，并检测影响成品率的光罩缺陷，例如在有图案区和无图案区的晶体增长或污染。此外，Teron SL650 拥有业界领先的产能，可支持更快的生产周期，以满足检验更多数量的先进技术光罩的需要。

KLA-Tencor 光罩产品事业部 (RAPID) 副总裁兼总经理熊亚霖博士称：“对于集成电路制造商而言，了解光罩状况是图案成像工艺控制的核心要素，因为光罩质量变化可能会对在印的每一片晶圆造成毁灭性影响。针对 Teron SL650，我们的团队在适合集成电路晶圆厂的一个紧凑平台上采用了最先进的光罩检测技术，生产出一款具有先进灵敏度、高产能和可扩展至未来节点能力的光罩质量控制系统。通过监测新光罩的关键缺陷，并在生产期间识别掩模图案的累积缺陷和变化，我们的 Teron SL650 能够帮助芯片制造商保证设备成品率、性能和生产周期。”

Teron SL650 利用 STARlightSD™ 和 STARlightMD™ 创造出更胜一筹的缺陷捕获率，以及分别在单芯片和多芯片光罩上的全面检测，藉此支持晶圆厂内各种类型的光罩。芯片制造商还可以使用创新型 STARlightMaps™ 技术来追踪光罩随着时间的退化，找出临界尺寸 (CD)、薄膜厚度、抗反射层以及光罩上的其他变量的变化——这些变化会影响光罩质量从而影响光刻工艺窗口或图案印刷。此外，Teron SL650 与超紫外线 (EUV) 检测技术兼容，能够与集成电路制造商及早协作，满足晶圆厂对 EUV 光罩的要求。

多台 Teron SL650 光罩检测系统已在世界各地的代工厂、逻辑电路与存储器生产厂安装，用于新光罩的质量检测，以及先进集成电路制造中所用光罩的重新检验。为了保持高性能和高产能，满足最先进的生产需要，Teron SL650 系统由 [KLA-Tencor 的全球综合服务网络](#) 提供支持。关于 Teron SL650 光罩检测系统的更多信息，请与 [光罩产品事业部 \(RAPID\)](#) 联系。

关于 KLA-Tencor:

KLA-Tencor 公司是工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商，它与全球客户合作，开发先进的检测与计量技术。这些技术为半导体、发光二极管 (LED) 及其他相关纳米电子产业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队，超过三十五年以来一直致力于为客户打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 的总部设在美国加利福尼亚州米尔皮塔斯 (Milpitas)，并在全球各地设有专属的客户运营与服务中心。如需更多信息，请访问网站 <http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)。

前瞻性声明:

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 Teron SL650 光罩检测系统的预期性能，Teron SL650 光罩检测系统相对于未来技术节点的可扩展性，半导体产业的趋势及其带来的预期挑战，KLA-Tencor 的客户对 Teron SL650 光罩检测系统的预期使用，以及 Teron SL650 光罩检测系统使用者可以实现的预期成本、运营与其他受益等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港”(Safe Harbor) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题），其他公司推出竞争性产品，或影响 KLA-Tencor 产品的实现、性能或使用的意外技术挑战或限制，实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。

###